

## scia systems

### scia Clean 1500 для плазменной очистки

scia Clean 1500 предназначен для очистки больших трёхмерных подложек термической десорбцией, вакуумной десорбцией и плазменной обработкой. Обычно применяется для очистки ультравысокой чистоты оптических компонентов и медицинских объектов.

scia Clean 1500 доступен с отдельными системами подогрева для камеры и для подложки. Это обеспечивает очень хорошее базовое давление, которое необходимо, чтобы количественно измерить даже небольшие остаточные загрязнения на подложке путем масс-спектрометрии. Очистка улучшена с помощью выбираемого количества источников плазмы в соответствии с требованиями заказчика. Система загрузки может быть использована для подложек весом до 3 тонн.

#### Особенности

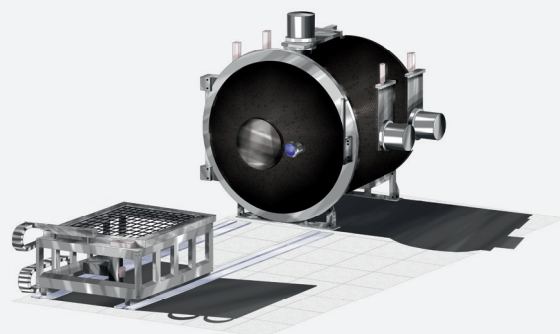
- Отдельные подогрев камеры и подложки
- Выбор количества источников плазмы
- Система передачи для загрузки больших трёхмерных подложек
- Управление качеством очистки с масс-спектрометром

#### Применение

- Ультра высокая очистка рентгеновской оптики
- Стерилизация медицинских объектов (например, имплантаты и стенты)
- Очистка и обезжиривание металлических поверхностей электрических устройств

#### Технические характеристики

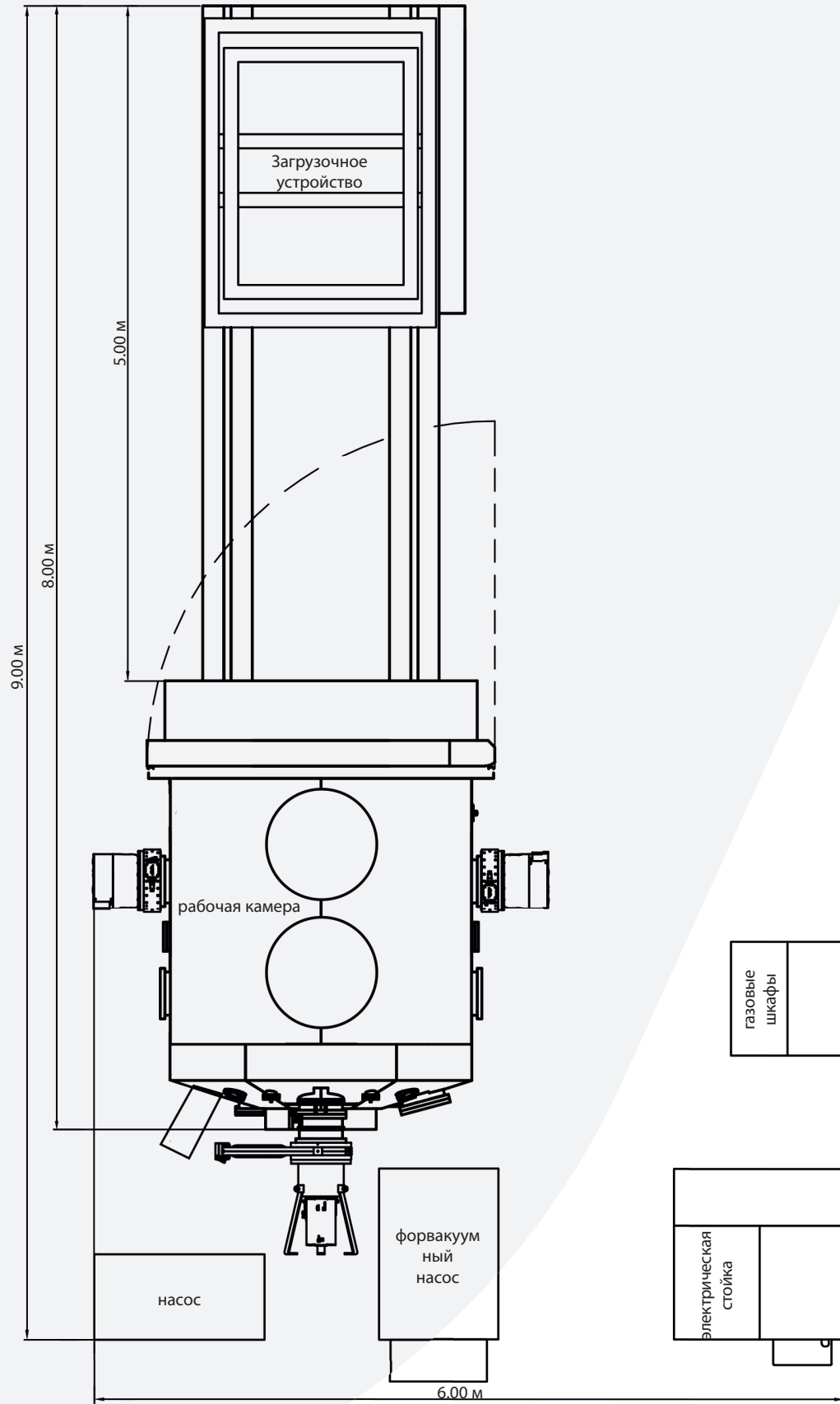
Размер камеры	2.00 м x 3.00 м x 2.00 м
Источники плазмы	Дополнительные источники плазмы PI400
Максимальная РЧ-мощность	2,5 кВт для каждого источника
Рабочие температуры	Камера: Охлаждение до 0°C; нагрев до 150°C Подложка: Нагрев до 250°C
Контроль качества	Масс-спектрометр для измерения уровня очистки
Базовое давление	$< 5 \times 10^{-8}$ мбарг
Размеры системы (Ш x Г x В)	9.00 м x 6.00 м x 4.00 м (с электрической стойкой и насосами)
Конфигурация	Система передачи с тележкой для подложки; Выбираемое количество источников плазмы, турбо или крио насос
Интерфейс ПО	SECS II / GEM



scia Clean 1500



Схема scia Clean 1500



Эскиз scia Clean 1500